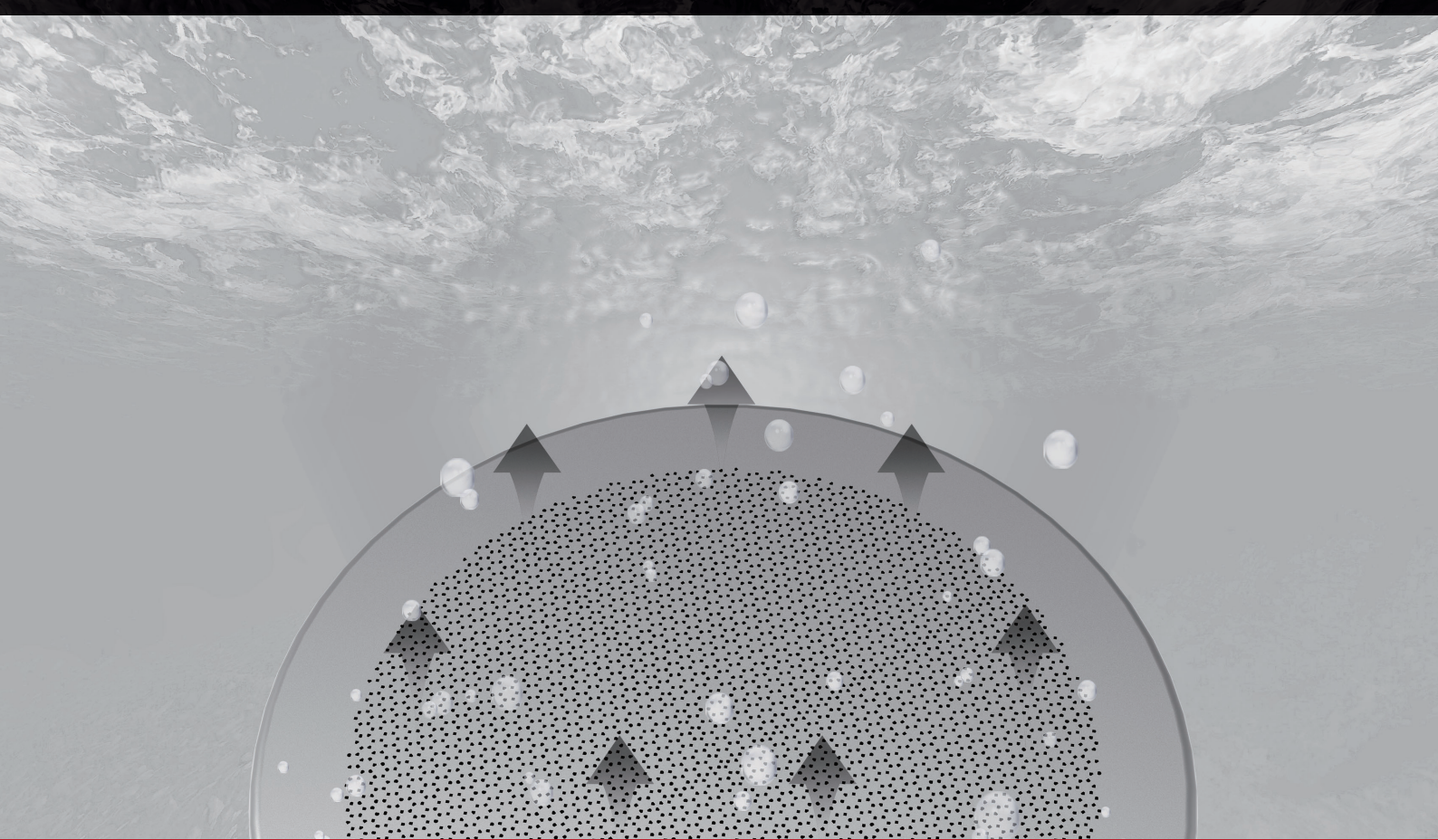




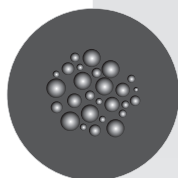
CINOS CLEANING TECHNOLOGY

SUPER SONIC CLEAN

SSC™



Pulsation



Various Size



Sensitive

CINOS

WE MAKE GLOBAL STANDARD



다양한 Size의 Particle로
오염된 Substrate

1



다양한 Frequency 사용으로
Small, Medium, Large Size Particle 제거

2



Particle이 제거된 Substrate

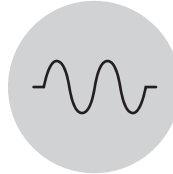
3

Machanism

일반적인 반도체 공정에서 사용되는 제품을 세정하기 위한 기술로는 침적, 스프레이, 건식 초음파 등의 방식을 적용하고 있으나 다양한 크기의 Particle에 대응하기 부적합하고 특히, Ultra Small Size Particle의 경우 크기로 인해 모재의 Zeta Potential의 영향으로 기존 방식은 제거가 어렵습니다. SSC™는 다양한 주파수를 발진시켜 각 주파수 별 다양한 크기의 Particle을 제거할 수 있으며, 그 중 High Frequency의 경우 Ultra Small Size Particle를 제거하여 Sensitive Cleaning에 적합한 기술입니다.

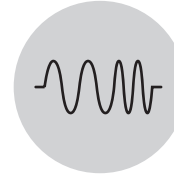
Benefits

3 Frequency Cleaning



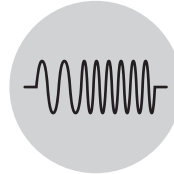
37 kHz

Large Size
Particle Remove



70 kHz

Medium Size
Particle Remove



120 kHz

Ultra Small Size
Particle Remove

Ultra Small ~ Large Size Particle 제거에 탁월한 세정기술, SSC™

Before

Normal
Ultra Sonic

SSC™

세정 전 대비 Alkali Metal Ion

90%
감소

Application

Best Solution For Alkali Metal Ion Cleaning

- ShowerHead
- ShowerHead Base
- Electrode Inner

ShowerHead Series



ShowerHead Base



Electrode Inner

